

Prensa En Caliente Automática De Vacío De 10T Para Prensado De Precisión De Laboratorio

Número de artículo: XP32



Introducción

Prensa en caliente automática de vacío de sobremesa de 10T de alta precisión con platos calientes de 200x200 mm y bomba de vacío rápida para curado de polímeros, unión de electrodos de baterías e investigación de materiales. Ideal para entornos de laboratorio que requieren calentamiento uniforme y control de presión de precisión, certificada CE con pantalla táctil programable.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio clave
Laminación de películas de polímero	Laminación de láminas o películas de polímero bajo calor y vacío para crear estructuras multicapa.	La presión y la temperatura uniformes evitan la deformación y los vacíos.
Unión de electrodos de batería	Unión de materiales de electrodos a colectores de corriente para baterías de iones de litio o estado sólido.	El purgado de gas inerte evita la oxidación, garantizando una alta conductividad.
Compactación de polvos (con troqueles)	Compactación de polvos metálicos, cerámicos o compuestos en pastillas densas utilizando un troquel más pequeño.	Presión alta de hasta 50.9 MPa alcanzable con troquel Ø50 mm.
Procesamiento de películas delgadas	Curado y recocido de películas delgadas para aplicaciones de electrónica y sensores.	Control de temperatura preciso hasta 300°C con ambiente de vacío.
Sinterizado de cerámica	Sinterizado en etapa inicial de cuerpos de cerámica en verde bajo calor y presión combinados.	Porosidad reducida y propiedades mecánicas mejoradas.
Curado de materiales compuestos	Curado de preimpregnados de fibra de carbono o fibra de vidrio.	La distribución uniforme de la presión garantiza la calidad de la laminación.
Encapsulado de electrónica orgánica	Encapsulado de dispositivos electrónicos orgánicos sensibles bajo atmósfera inerte.	El ambiente libre de oxígeno extiende la vida útil del dispositivo.

Parámetro	Especificación	Notas
Modelo	XP32	Prensa de vacío calentada automática
Presión máxima de trabajo	≤ 10 Toneladas (100 kN)	Controlado mediante sistema programable
Precisión de presión	± 0.1 Tonelada (1 kN)	Retroalimentación de carga de alta precisión
Temp. de trabajo del plato	Temp. ambiente (RT) - 300 °C	Pantalla táctil PID programable
Potencia de calefacción	3500 W	Matriz de elementos de calefacción de alta densidad
Dimensiones del plato	200 mm × 200 mm	Platos planos rectificados
Apertura del plato (Luz)	50 mm	Apertura compacta para ciclo de vacío rápido
Bomba de vacío incluida	Bomba mecánica de paletas rotativas	Inclusión estándar
Desplazamiento de la bomba de vacío	240 L/min (8.5 CFM)	Capacidad de evacuación de alta velocidad

Parámetro	Especificación	Notas
Nivel de vacío último	< -0.1 MPa	Presión manométrica relativa
Atmósfera de trabajo	Nitrógeno (N ₂) / Argón (Ar)	Compatible con vacío y purgado
Suministro eléctrico	CA 208V / 60Hz (Monofásico)	Optimizado para instalaciones institucionales de EE. UU.
Certificación	Certificado CE	Cumplimiento de seguridad estándar

Opción	Controlador estándar (Incluido)	Actualización a PLC industrial avanzado (Opcional)
Interfaz	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas	PLC industrial Siemens con pantalla táctil de alta resolución
Funciones principales	Perfilado básico de temperatura PID, entrada de presión objetivo, mantenimiento automático, descompresión temporizada automatizada	Perfilado complejo de temperatura/presión de múltiples pasos, almacenamiento de recetas (hasta 99 perfiles), retroalimentación de celda de carga de precisión, registro de datos Ethernet
Ideal para	Laminación estándar, curado de polímeros, prensado simple de pastillas	Investigación académica, estándares de prueba ASTM, procesos que requieren compensación de presión paso a paso precisa